Partial English Translation of Japanese Patent Laying-open No. 2001-075068

[0043]

Subsequently, polarizing plates 6a and 6b are attached to an individual liquid crystal panel portion on the opposite, front and rear surfaces excluding a portion having a mark 26 attached thereto (in Fig. 3, step P13). The liquid crystal panel portion with mark 26 attached thereon thus does not have polarizing plates 6a and 6b attached thereto.

[0044]

Thereafter in step P14 a medium panel structure 2' is subjected to a second break. More specifically, with reference to Fig. 7, first and second substrate base materials 18a' and 18b' are both cut along a second cutting line L2. Thus the liquid crystal device 1 shown in Fig. 1 is divided one by one. The second break can also be implemented by scribing, laser-cutting or a variety of other cutting techniques. Desirably, it is done by laser-cutting.

Fig. 3

P1: Provide 1st electrode

P2: Provide overcoating layer

P3: Provide oriented film

P4: Provide seal

P5: Provide 2nd electrode

P6: Provide overcoating layer

P7: Provide oriented film

P8: Assemble substrate

P9: 1st break

P10: Introduce & seal liquid crystal

P11: Conduct inspection (marking)

P12: Mount IC (on portion other than marked portion)

P13: Attach polarizing plate (on portion other than marked portion)

P14: 2nd break

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-075068

(43)Date of publication of application: 23.03.2001

(51)Int.Cl.

GO2F 1/13 G02F 1/1341 G09F 9/00

(21)Application number: 11-252206

SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

06.09.1999

(71)Applicant: (72)Inventor:

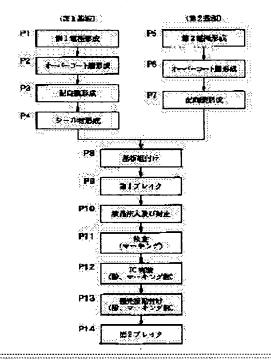
MURAMATSU EIJI

(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the execution of an inspection process in a process for producing a liquid crystalt device and to prevent the useless consumption of ICs, polarizing plates, etc., for driving liquid crystals.

SOLUTION: A large-sized panel structure is formed by bonding a pair of substrates formed with electrodes for a plurality of liquid crystal panels to each other (process P8); a middlesized panels exposed with the liquid crystal injection ports for the respective liquid crystal panel components to the outside is formed by cutting the large-sized panel structure (process P9); liquid crystals are injected into the respective liquid crystal panel portions through the exposed liquid crystal injection ports (process P10); the inspection relating to the respective liquid crystal panel portions after liquid crystal injection is carried out and the defective panel portions are marked (process P11); the unmarked non- defective liquid crystal panel portions are subjected to packaging of the ICs and sticking of the polarizing plates (processes P12 and 13); and thereafter the middle-sized panel structure is divided into the individual liquid crystal panels, by which one piece of the liquid crystal panel is



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-75068 (P2001-75068A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

2H089 NA24 QA12 QA13 TA03 TA04

5G435 AA17 BB12 FE33 EE37 EE42 FF00 FF05 HH12 KK05 KK10

TA15

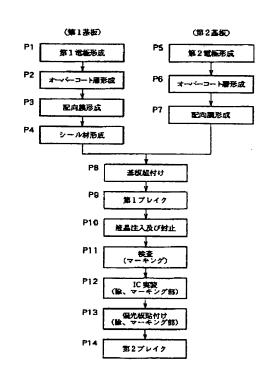
(51) Int.Cl. ⁷ G 0 2 F	1/13	識別記号 101	F I デーマコート*(参考) G O 2 F 1/13 1 O 1 2 H O 8 8
	1/1341		1/1341 2 H 0 8 9
G 0 9 F	9/00	3 4 0	G09F 9/00 340A 5G435
		3 4 3	3 4 3 D
			審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)
(21)出願番号		特願平11-2522 06	(71)出顧人 000002369
(22)出顧日		平成11年9月6日(1999.9.6)	セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 村松 永至 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株式会社内 (74)代理人 100093388 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)
			Fターム(参考) 2H088 FA07 FA10 FA11 FA16 HA03 HA18 MA16

(54) 【発明の名称】 液晶装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 液晶装置の製造方法における検査工程を容易に行えるようにすること及び液晶駆動用 I C や偏光板等といった要素が無駄に消費されるのを防止する。

【解決手段】 液晶パネル複数分の電極が形成された一対の基板を互いに貼り合わせて大判パネル構造を形成し(工程P8)、その大判パネル構造を切断して各液晶パネル部分の液晶注入口が外部に露出する中判パネル構造を形成し(工程P9)、その液晶注入口を通して各液晶パネル部分の内部へ液晶を注入し(工程P10)、液晶注入後の各液晶パネル部分に関して検査を行って不良のものにマークを付け(工程P11)、マークのない良品の液晶パネル部分に対してIC実装や偏光板の貼付けを行い(工程P12,13)、その後に中判パネル構造を個々の液晶パネルに分割して1個の液晶パネルを形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶パネル複数分の第1電極が形成された第1基板母材と液晶パネル複数分の第2電極が形成された第2基板母材とを互いに貼り合わせて複数の液晶パネル部分を含む大判パネル構造を形成する基板組付け工程と、

前記大判パネル構造を切断して前記複数の液晶パネル部分の液晶注入口が外部に露出する中判パネル構造を形成する第1プレイク工程と、

露出した前記液晶注入口を通して各液晶パネル部分の内 10 部へ液晶を注入する液晶注入工程と、

液晶が注入された前記中判パネル構造に対して行われる 付加工程と、

その付加工程の後に前記中判パネル構造を個々の液晶パネルに分割する第2プレイク工程とを有する液晶装置の 製造方法において、

前記中判パネル構造に含まれる前記複数の液晶パネル部分に対して検査を行い不良の液晶パネル部分にマーキングを行う検査工程を、前記液晶注入工程と前記付加工程との間に設け、

前記付加工程は前記マーキングが成されていない液晶パネル部分に対して行われることを特徴とする液晶装置の 製造方法。

【請求項2】 請求項1において、前記付加工程は、前 記液晶パネルにICチップを実装するIC実装工程及び /又は前記液晶パネルに偏光板を貼付する偏光板貼付け 工程であることを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記第2プレイク工程ではレーザ光線を用いて切断が行われることを特徴とする液晶装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一対の基板間に封止した液晶の配向を制御することによって文字、数字、 絵柄等といった像を表示する液晶装置の製造方法に関する

[0002]

【従来の技術】液晶装置は、一般に、一対の基板間に液晶を封入した構造の液晶パネルに、バックライト等といった照明装置や液晶駆動用IC等といった付加機器を付40設することによって形成される。また、液晶パネルは、一般に、第1電極が形成された第1基板と第2電極が形成された第2基板とをシール材によって互いに貼り合わせ、それらの基板間に形成される間隙、いわゆるセルギャップ内に液晶を封入することによって形成される。

【0003】上記の液晶装置を製造する方法として、従れる前記複数の液晶パネル部分に対して根来、液晶パネル複数分の第1電極が形成された第1基板母材と液晶パネル複数分の第2電極が形成された第2基板母材とを互いに組み合わせて複数の液晶パネル部分を含む大判パネル構造を形成し、次に前記大判パネル構造 50 部分に対して行われることを特徴とする。

を切断して前記複数の液晶パネル部分の液晶注入口が外部に露出する構造の中判パネル構造を形成し、次に前記の露出した液晶注入口を通して各液晶パネル部分の内部へ液晶を注入し、次に前記中判パネル構造を個々の液晶パネルに分割し、次に前記の分割された個々の液晶パネルに偏光板を貼付するという一連の工程から成る製造方法が知られている。

【0004】また、偏光板を貼り付ける工程に先立って、必要に応じて、液晶駆動用IC等といったICチップを液晶パネルに実装するIC実装工程が実行されることもある。

【0005】上記従来の液晶装置の製造方法においては、上述した全ての工程が完了して1個ずつの液晶パネルが製造された後に、個々の液晶パネルに対して点灯検査が行われ、その検査によって良品と判定されたものが製品となり、不良品と判定されたものは廃棄されていた。

[0006]

20

【発明が解決しようとする課題】上記従来の液晶装置の製造方法においては、液晶パネルが1個ずつに分断された後に点灯検査が行われていたので、その点灯検査に手間がかかるという問題があった。また、液晶駆動用1Cや偏光板を装着する前の液晶パネルに不良が有る場合、その不良の液晶パネルに対しても液晶駆動用1Cや偏光板が装着されてしまうので、非常に不経済であった。

【0007】本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたりものであって、液晶装置の製造方法における検査工程を容易に行えるようにすること及び液晶駆動用ICや偏光板等といった要素が無駄に消費されるのを防止することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】(1) 上記の目的を達 成するため、本発明に係る液晶装置の製造方法は、液晶 パネル複数分の第1電極が形成された第1基板母材と液 晶パネル複数分の第2電極が形成された第2基板母材と を互いに貼り合わせて複数の液晶パネル部分を含む大判 パネル構造を形成する基板組付け工程と、前記大判パネ ル構造を切断して前記複数の液晶パネル部分の液晶注入 口が外部に露出する中判パネル構造を形成する第1プレ イク工程と、露出した前記液晶注入口を通して各液晶パ ネル部分の内部へ液晶を注入する液晶注入工程と、液晶 が注入された前記中判パネル構造に対して行われる付加 工程と、その付加工程の後に前記中判パネル構造を個々 の液晶パネルに分割する第2ブレイク工程とを有する液 晶装置の製造方法において、前記中判パネル構造に含ま れる前記複数の液晶パネル部分に対して検査を行い不良 の液晶パネル部分にマーキングを行う検査工程を、前記 液晶注入工程と前記付加工程との間に設け、そして前記 付加工程は前記マーキングが成されていない液晶パネル

【0009】この液晶装置の製造方法によれば、1個ず つに分断された液晶パネルの個々について検査が行われ るのではなく、複数の液晶パネルを含む中判のパネル構 造に対して検査が行われるので、液晶装置の製造方法に おける検査工程を容易に行うことができる。

【0010】また、液晶駆動用ICや偏光板等といった 要素を装着するための付加工程はマーキングが成されて いない液晶パネル部分に対してだけ、すなわち良品の液 晶パネルに対してだけ行われるので、液晶駆動用ICや 偏光板等といった要素が無駄に消費されることを防止で きる。

【0011】(2) 上記構成の液晶装置の製造方法に おいて、前記付加工程としては、前記液晶パネルにIC チップを実装するIC実装工程及び/又は前記液晶パネ ルに偏光板を貼付する偏光板貼付け工程を考えることが できる。但し、これらの工程以外に中判パネル構造に対 して実行すべきその他の工程がある場合には、そのよう な工程も付加工程と考えることができる。

【0012】(3) パネル構造の切断については、ガ ラス、プラスチック等の基板にスクライブ溝と呼ばれる 20 溝を形成し、そのスクライブ溝を基準にして基板を力に よって分割するという切断方法が広く知られている。し かしながら、この切断方法に代えて、レーザ光線を用い てパネル構造を切断することもできる。

【0013】スクライブ溝を使って切断を行う場合に は、その切断によって形成された液晶パネルの切断面に はマイクロクラックと呼ばれる微小なクラックが発生 し、このマイクロクラックを基点として液晶パネルに亀 裂が発生するおそれがある。これに対し、レーザ光線を 用いて液晶パネルの基板を切断するようにすれば、その 30 基板の切断面はスクライブ方法を用いた場合に比べて著 しく滑らかとなり、マイクロクラックも発生しない。よ って、液晶パネルの損傷を未然に防止できる。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明に係る液晶装置の製造方法 を説明する前に、まず、その製造方法を用いて作製され る液晶装置について説明する。図1は、その液晶装置の 一実施形態を示している。この液晶装置1は、液晶パネ ル2にICチップとしての液晶駆動用IC3を実装する ことによって形成される。また、液晶パネル2の一方の 40 面には、必要に応じて、バックライト等といった照明装 置や光反射板等が設けられる。

【0015】液晶パネル2は、互いに対向する一対の基 板4a及び4bを有し、これらの基板はシール材7によ ってそれらの周囲が互いに接着される。これらの基板4 a及び4bは、例えばガラス等といった硬質な光透過性 材料や、プラスチック等といった可撓性を有する光透過 性材料等によって形成された基板素材に電極その他の必 要要素を形成することによって作製される。

aの液晶側表面、すなわち第2基板4bに対向する面に は、例えばコモン電極として作用する第1電極9aが所 定のパターンに形成され、その上にオーバーコート層1 1 a が形成され、さらにその上に配向膜 1 2 a が形成さ れる。また、基板素材8aの外側表面には偏光板6aが 貼着される。

【0017】第1基板4aに対向する第2基板4bの液 晶側表面、すなわち第1基板4aに対向する面には、例 えばセグメント電極として作用する第2電極9bが所定 のパターンに形成され、その上にオーバーコート層11 bが形成され、さらにその上に配向膜12bが形成され る。また、基板素材8 b の外側表面には偏光板6 b が貼 着される。

【0018】第1電極9a及び第2電極9bは、例えば ITO (Indium Tin Oxide) 等の透明電極によって10 00オングストローム程度の厚さに形成され、オーバー コート層11a及び11bは、例えば酸化珪素、酸化チ タン又はそれらの混合物等によって800オングストロ ーム程度の厚さに形成され、そして配向膜12a及び1 2 bは、例えばポリイミド系樹脂によって800オング ストローム程度の厚さに形成される。

【0019】第1電極9aは、図1に示すように、複数 の直線パターンを互いに平行に配列することによって、 いわゆるストライプ状に形成され、一方、第2電極9b は上記第1電極9aに交差するように複数の直線パター ンを互いに平行に配列することによって、やはりストラ イプ状に形成される。これらの電極9aと電極9bとが ドットマトリクス状に交差する複数の点が、像を表示す るための画素を形成する。そして、それら複数の画素に よって区画形成される領域が、文字等といった像を表示 するための表示領域となる。

【0020】以上のようにして形成された第1基板4a 及び第2基板4bのいずれか一方の液晶側表面には、図 2に示すように、複数のスペーサ13が分散され、さら にいずれか一方の基板の液晶側表面にシール材7が例え ば印刷等によって図1に示すように枠状に設けられる。 このシール材7の内部には図2に示すように導通材16 が分散される。また、シール材7の一部には図1に示す ように液晶注入口7aが形成される。

【0021】両基板4a及び4bの間にはスペーサ13 によって保持される均一な寸法、例えば5μm程度の間 隙、いわゆるセルギャップが形成され、液晶注入口7a を通してそのセルギャップ内に液晶14が注入され、そ の注入の完了後、液晶注入ロ7aが樹脂等によって封止 される。

【0022】図1において、第1基板4aは第2基板4 bの外側へ張り出す基板張出し部4cを有し、第1基板 4 a 上の第1電極 9 a はその基板張出し部 4 c へ直接に 延び出て配線パターン15となっている。また、第2基 【0016】図2において、第1基板4aの基板素材8 50 板4b上の第2電極9bは、シール材7の内部に分散し

5

た導通材16(図2参照)を介して、基板張出し部4c 上の配線パターン15に接続している。符号20は、図 示しない外部回路との間で電気的な接続をとるための外 部接続端子を示している。

【0023】各電極9a及び9b、それらから延びる配線パターン15並びに外部接続端子20は、実際には極めて狭い間隔で多数本がそれぞれの基板4a及び4bの表面全域に形成されるが、図1及びこれから説明する各図では構造を分かり易く示すために実際の間隔よりも広い間隔でそれらの電極等を模式的に図示し、さらに一部の電極の図示は省略してある。また、液晶が封入される領域内に形成される電極9a及び9bは、直線状に形成されることに限られず、適宜のパターン状に形成されることもある。

【0024】図1において、液晶駆動用IC3の能動面3 aには、IC側端子としてのバンプ21が形成される。本実施形態では液晶駆動用IC3を液晶パネル2の基板張出し部4cの上に直接に実装する構造の、いわゆるCOG (Chip On Glass) 方式の液晶装置を考えることにする。液晶駆動用IC3を基板張出し部4cの上に実装するに際しては、まず、液晶駆動用IC3を実装すべき領域であってそのIC3とほぼ同じ面積の領域である1C実装領域Jに、接着用材料としてのACF (Anisotropic Conductive Film: 異方性導電膜) 17を貼着し、次いで液晶駆動用IC3の能動面3aをACF17に貼り付け、これにより液晶駆動用IC3をIC実装領域Jに仮装着する。

【0026】このACF17を挟んで基板張出し部4cと液晶駆動用IC3とを熱圧着、すなわち加熱下で加圧することにより、液晶駆動用IC3を基板張出し部4cに接着すると共に、液晶駆動用IC3のバンプ21と基板張出し部4c上の配線パターン15との間及び液晶駆動用IC3のバンプ21と基板張出し部4c上の外部接続端子20との間において単一方向の導電性を持つ接続を実現する。

【0027】以上のように構成された液晶装置1に関して、液晶駆動用1C3によって第1電極9a又は第2電極9bのいずれか一方に対して行ごとに走査電圧を印加し、さらにそれらの電極の他方に対して表示画像に基づいたデータ電圧を画素ごとに印加することにより、両電圧の印加によって選択された各画素部分を通過する光変調し、もって、基板4a又は4bの外側に文字、数字等といった像を表示する。

【0028】以下、上記構成から成る液晶装置1を製造 50 いに導電接続される。以上により、液晶パネル2を複数

するための製造方法について、図3に示す工程図を参照 にして説明する。

【0029】まず、図4に示すように、液晶パネル2を構成する第1基板4aの複数個分の大きさを有する大判の第1基板母材18aの個々の液晶パネル基板部分4aに、図6(a)に示すように、第1電極9a、配線パターン15及び外部接続端子20をITOを材料として周知のパターン形成法、例えばフォトリングラフィー法によって形成する(図3の工程P1)。図6(a)において配線パターン15及び外部接続端子20の先端が集まる領域が液晶駆動用IC3(図1参照)を実装するためのIC実装領域Jになる。

【0030】次に、オーバーコート層11a(図2参照)を図4の第1基板母材18aの表面に、例えば酸化珪素、酸化チタンを材料としてオフセット印刷によって形成する(図3の工程P2)。そしてその上に、例えばポリイミド系樹脂を材料としてオフセット印刷によって配向膜12a(図2参照)を形成する(図3の工程P3)。さらにその上に、例えばエポキシ系樹脂の中に導通材を分散して成る材料を用いてスクリーン印刷によってシール材7を枠形状に形成する(図3の工程P4)。これにより、図4に示すような、大判の第1基板母材18aが形成される。なお、図4では、便宜上オーバーコート層及び配向膜の図示を省略してある。

【0031】他方、図5に示すように、液晶パネル2を構成する第2基板4bの複数個分の大きさを有する大判の第2基板母材18bの個々の液晶パネル基板部分4bに、図6(b)に示すように、第2電極9bをITOを材料として周知のパターン形成法、例えばフォトリングラフィー法によって形成する(図3の工程P5)。

【0032】次に、オーバーコート層11b(図2参照)を図5の第2基板母材18bの表面に、例えば酸化珪素、酸化チタンを材料としてオフセット印刷によって形成する(図3の工程P6)。そしてその上に、例えばポリイミド系樹脂を材料としてオフセット印刷によって配向膜12b(図2参照)を形成する(図3の工程P7)。これにより、図5に示すような、大判の第2基板母材18bが形成される。なお、図5では、便宜上オーバーコート層及び配向膜の図示を省略してある。

【0033】以上により、第1基板母材18a(図4)及び第2基板母材18b(図5)が作製された後、図3の工程P8において、第1基板母材18aと第2基板母材18bとをシール材7を間に挟んで重ね合わせ、さらに圧着すること、すなわち加熱下で加圧することにより、両基板を互いに貼り合わせる。

【0034】この貼り合わせにより、第2基板4b上の第2電極9bの先端(図6(b)参照)と、第1基板4a上の配線パターン15(図6(a)参照)とがシール材7中に分散された導通材16(図2参照)によって互いに遵電接続される。以上により、液晶パネル2を複数

40

20

7

個含む大きさの大判パネル構造が形成される。なお、第 1基板母材18aと第2基板母材18bとを貼り合わせ る際には、図4に示す第1基板母材18a又は図5に示 す第2基板母材18bのいずれか一方を図示の状態から 裏返した状態で他の基板母材と貼り合わす。

【0035】以上のようにして大判のパネル構造が作製された後、このパネル構造に対して第1ブレイク工程を実施する(図3の工程P9)。具体的には、パネル構造を構成する第1基板母材18aに関して図4に示す第1切断線L10に沿って該基板母材を切断し、一方、第2基板母材18bに関して図5に示す第1切断線L11に沿って該基板母材を切断する。

【0036】これにより、図7に示すように、短冊状の第1基板母材18a,及び短冊状の第2基板母材18 b,が互いに貼り合わされた状態の中判パネル構造2, が複数個作製される。これらの中判パネル構造2,に関 しては、それらに含まれる各液晶パネル部分の液晶注入 口7aが外部へ露出する構造となっている。

【0037】なお、工程P9におけるパネル構造の切断作業は、例えばスクライブ法、レーザカット法等を用いて行うことができる。スクライブ法は、切断線L10及び切断線L11に沿ってスクライブ溝、すなわち切断溝を形成し、パネル構造をそれらのスクライブ溝の裏側から叩くことにより、切断線L10及びL11の所でパネル構造を分断する方法である。

【0038】また、レーザカット法は、図8に模式的に示すように、レーザ発射装置23から発射されるレーザ光線、例えば赤外線レーザ光Rを第1基板母材18a又は第2基板母材18b上で矢印Aのように走査移動させることにより、そのレーザ光Rがあたった所から基板母材18a又は18bを分断する方法である。

【0039】以上のようにして中判パネル構造2'(図7)が作製された後、それに含まれる複数の液晶パネル部分に関して、外部へ露出する液晶注入口7aを通して液晶を注入し、さらにその注入の完了後にその液晶注入口7aを樹脂によって封止する(図3の工程P10)。

【0040】その後、工程P11において点灯検査を実行する。具体的には、中判パネル構造2'に含まれる複数の液晶パネル部分に関してそれらの配線パターン15の個々に点灯検査用の駆動信号を供給する。この駆動信号は、例えば複数の液晶パネル部分の表示領域を均一に点灯させるためのものであり、この点灯状態を観察したときに表示領域内に不点灯の部分が存在すれば、その液晶パネルは不良と判定される。

【0041】不良と判定された液晶パネル部分、図7では左から2番目の液晶パネル部分の適所には、その液晶パネル部分が不良品であることを表示するための適宜のマーク26が付けられる。すなわち、マーキングの処理が施される。このマーク26は、オペレータによって手動で付すこともできる1. あるいは 商宜の構造の自動

機を用いて自動的に付すこともできる。

【0042】検査の終了後、マーク26が付された液晶パネル部分を除いて、個々の液晶パネル部分のIC実装領域JにACF17を貼着し、さらにそのACF17の上に液晶駆動用IC3を貼着、すなわち仮装着し、さらに加熱された圧着ヘッドによってそれらの液晶駆動用IC3を押圧することにより、マーク26が付された液晶パネル部分を除いた各液晶パネル部分のIC実装領域Jに液晶駆動用IC3を実装する(図3の工程P12)。

【0043】次に、マーク26が付された液晶パネル部分を除いて、個々の液晶パネル部分の表裏両面に偏光板6a及び偏光板6bをそれぞれ貼着する(図3の工程P13)。マーク26が付された液晶パネル部分には偏光板6a及び偏光板6bを貼着しない。

【0044】そしてその後、工程P14において中判パネル構造2'に対して第2ブレイクを実行する。すなわち、図7において第2切断線L2に沿って第1基板母材18a'及び第2基板母材18b'の両方を切断し、これにより、図1に示す液晶装置1が1個ずつ分断される。なお、この第2ブレイクもスクライブ法、レーザカット法等といった各種の切断法を用いて行うことができるが、望ましくはレーザカット法を利用して切断を行う。

【0045】レーザカット法を用いた方が望ましいことの理由は次の通りである。すなわち、スクライブ法を用いる場合には、液晶パネル基板の切断面にマイクロクラックと呼ばれる微小なクラックが発生し、このマイクロクラックを基点として液晶パネルに亀裂が発生するおそれがあるのに対し、レーザカット法を用いると、液晶パネル基板の切断面はスクライブ法を用いた場合に比べて著しく滑らかとなり、よって、液晶パネルの損傷を未然に防止できるからである。

【0046】(その他の実施形態)以上、好ましい実施 形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形 態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明 の範囲内で種々に改変できる。

【0047】例えば、以上の説明では液晶駆動用IC3を基板4a又は4bの上に直接に実装する構造のCOG方式の液晶装置を例示したが、液晶パネルを作製した後にFPC (Flexible Printed Circuit) によって液晶駆動用IC3を液晶パネルに接続する構造の液晶装置に関しては、液晶駆動用IC3を実装する前の液晶パネルを製造する工程において本発明を適用することができる。

【0048】図7では、不良の液晶パネル部分に対応して「×」のようなマークを付することにしたが、マークの形状はこれに限られず、希望に応じた任意の形状とすることができる。

[0049]

が施される。このマーク26は、オペレータによって手 【発明の効果】本発明に係る液晶装置の製造方法によれ 動で付すこともできるし、あるいは、適宜の構造の自動 50 ば、1個ずつに分断された液晶パネルの個々について検

【符号の説明】

10

•

査が行われるのではなく、複数の液晶パネルを含む中判のパネル構造に対して検査が行われるので、液晶装置の 製造方法における検査工程を容易に行うことができる。

【0050】また、液晶駆動用ICや偏光板等といった 要素を装着するための付加工程はマーキングが成されて いない液晶パネル部分に対してだけ、すなわち良品の液 晶パネルに対してだけ行われるので、液晶駆動用ICや 偏光板等といった要素が無駄に消費されることを防止で きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る液晶装置の製造方法によって製造される液晶装置の一例を一部分解して示す斜視図である。

【図2】図1の液晶装置の要部の断面図である。

【図3】本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態 を示す工程図である。

【図4】図3の工程P1~P4を経て作製される第1基板母材を示す平面図である。

【図5】図3の工程P5~P7を経て作製される第2基板母材を示す平面図である。

【図6】(a)は図4の液晶パネル1個分の部分を示し、(b)は図5の液晶パネル1個分の部分を示す図である。

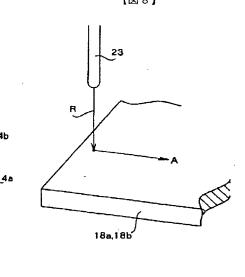
【図7】中判パネル構造の一例を一部分解して示す斜視 図である。

【図8】基板のプレイク方法の一例であるレーザカット 法を模式的に示す斜視図である。

	\$10 12 02 DE 013	
	1	液晶装置
	2	液晶パネル
	2'	中判パネル構造
	3	液晶駆動用IC
	3 a	能動面
	4 a	第1基板
	4 b	第2基板
	4 c	基板張出し部
10	ба, бъ	偏光板
	7	シール材
	7 a	液晶注入口
	8 a	第1基板素材
	8 Ъ	第2基板素材
	9 a	第1電極
	9 Ъ	第2電極
	1 4	液晶
	1 5	配線パターン
	1 8 a	第1基板母材
20	18 a'	中判の第1 基板母材
	1 8 b	第2基板母材
	18b'	中判の第2基板母材
	2 0	外部接続端子
	J	IC実装領域
	L10, L11	第1切断線
	L 2	第2切断線
	_	

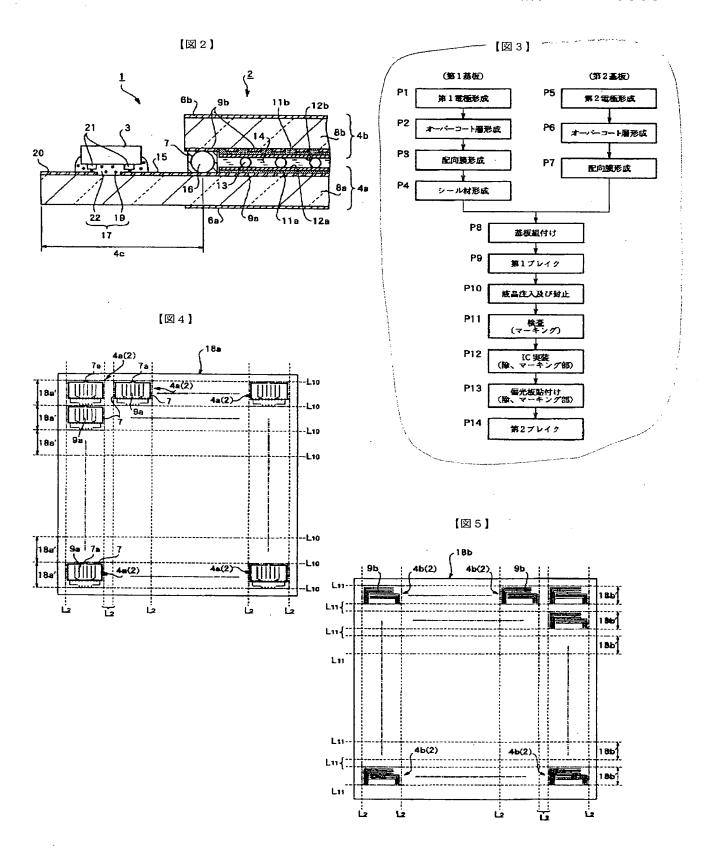
レーザ光

【図1】

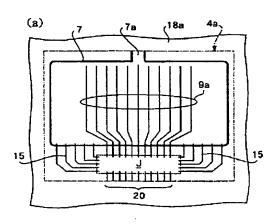


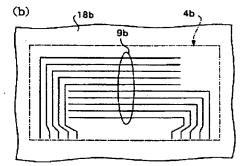
[図8]

R



【図6】





【図7】

